【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和1年5月23日(2019.5.23)

【公開番号】特開2018-76546(P2018-76546A)
【公開日】平成30年5月17日(2018.5.17)
【年通号数】公開・登録公報2018-018
【出願番号】特願2016-217287(P2016-217287)
【国際特許分類】
Ｃ２３Ｃ　4/04　(2006.01)
Ｃ０１Ｆ　17/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ２３Ｃ　4/04
Ｃ０１Ｆ　17/00　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成31年4月11日(2019.4.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
構成元素として、希土類元素、酸素およびハロゲン元素を含み、
希土類元素オキシハロゲン化物と希土類元素ハロゲン化物との混晶を含む、溶射用材料。
【請求項２】
前記希土類元素のハロゲン化物である希土類元素ハロゲン化物を実質的に含まない、請求項１に記載の溶射用材料。
【請求項３】
前記希土類元素の酸化物である希土類元素酸化物を実質的に含まない、請求項１または２に記載の溶射用材料。
【請求項４】
前記希土類元素オキシハロゲン化物を実質的に含まない、請求項１～３のいずれか１項に記載の溶射用材料。
【請求項５】
前記混晶における前記希土類元素ハロゲン化物の割合は、５モル％以上９５モル％以下である、請求項１～４のいずれか１項に記載の溶射用材料。
【請求項６】
前記希土類元素としてイットリウムを含み、
前記ハロゲン元素としてフッ素を含み、
前記希土類元素オキシハロゲン化物としてイットリウムオキシフッ化物を含み、
前記希土類元素ハロゲン化物としてフッ化イットリムを含む、
請求項１～５のいずれか１項に記載の溶射用材料。
【請求項７】
平均粒子径が５μｍ以上６０μｍ以下の粉体である、
請求項１～６のいずれか１項に記載の溶射用材料。
【請求項８】
前記粉体における細孔半径が１μｍ以下の累積細孔容積は、０．１ｃｍ^3／ｇ以下であ

る、請求項７に記載の溶射用材料。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
そこで従来より、半導体デバイス製造装置においては、パーティクルの発生を低減させる目的で、酸素ガスやハロゲンガス等のプラズマに晒される部材に、耐プラズマエロージョン性を備えるセラミックの溶射皮膜を設けることが行われている。例えば、特許文献１には、イットリウムオキシフッ化物が高い耐プラズマエロージョン性を備え得ることが開示され、少なくとも一部にイットリウムのオキシフッ化物を含む顆粒（造粒粒子）を溶射用材料として用いることが記載されている。